

TECHNOLOGIA CHEMICZNA IV ROK

laboratorium

Temat ćwiczenia		Prowadzący
A	Określenie parametrów formowania szkielek i emalii	dr inż. I. Grelowska
B	Kontrola procesu odprężania i hartowania szkielek	dr inż. M. Ciecierska
C	Określenie parametrów krystalizacji szkielek	dr hab. inż. K. Cholewa-Kowalska, prof. AGH
D	Korozja szkielek	dr inż. I. Grelowska
E	Analiza termomechaniczna szkielek i procesy termiczne powstawania masy szklanej	dr hab. inż. M. Środa, prof. AGH
F	Powłoki ochronne dla podłoża metalicznych	dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH
G	Ocena przyczepności powłok emalierskich	dr inż. M. Ciecierska
H	Kontrola zestawu szklarskiego	dr inż. I. Grelowska
I	Otrzymywanie warstw amorficznych metodą elektroforetyczną	dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH
J	Kontrola napięć powierzchniowych szkielek w procesie formowania powłoki	dr hab. inż. M. Środa, prof. AGH

08:00 – 11:45 wtorek

	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7
04.10.2022	D – 218	C – 219	J – 512	I – 312
11.10.2022	F – 512	D – 218	C – 219	G – 312
18.10.2022	B – 512	I – 312	D – 218	C – 219
25.10.2022	E – 219	B – 512	I – 312	D – 218
08.11.2022	A – 219	E – 218	B – 512	F – 312
15.11.2022	I – 312	A – 219	E – 218	B – 512
22.11.2022	G – 312	F – 512	A – 219	E – 218
29.11.2022	J – 218	G – 312	F – 512	A – 219
06.12.2022	H – 218	H – 218	G – 312	J – 219
13.12.2022	C – 219	J – 312	H – 218	H – 218

08:00 – 11:45 czwartek

	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
06.10.2022	D – 219	I – 312	B – 512
13.10.2022	H – 512	G – 312	C – 219
20.10.2022	G – 312	C – 219	D – 218
27.10.2022	C – 219	D – 218	I – 312
03.11.2022	E – 219	H – 512	G – 312
10.11.2022	F – 312	E – 219	H – 512
17.11.2022	A – 219	F – 312	E – 512
24.11.2022	J – 512	A – 219	F – 312
01.12.2022	B – 512	J – 312	A – 219
08.12.2022	I – 312	B – 512	J – 219